



ZEPTOOLS
TOOLS FOR SMALL WORLD.

电子束 光刻机

ZEL304G

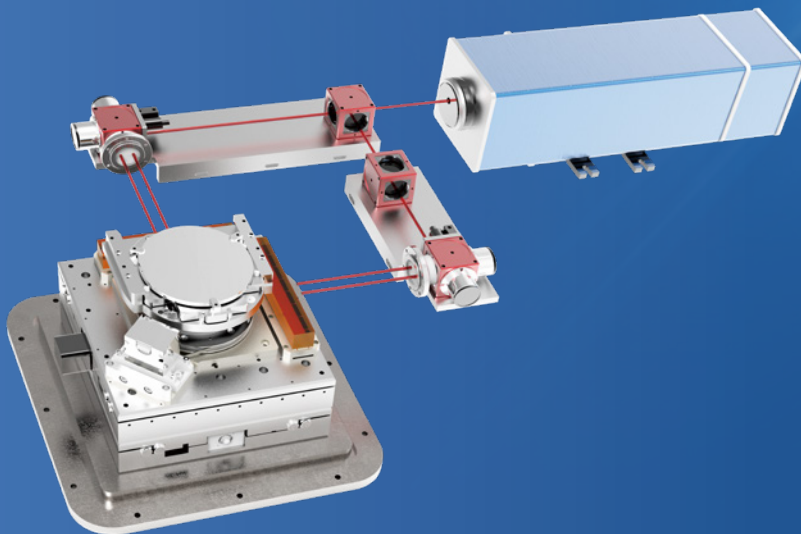
ZEL304G电子束光刻机（EBL）采用场发射电子枪，配合一体化的高速图形发生系统实现对半导体晶圆的高速、高分辨光刻。该系统标配高精度激光干涉样品台，允许用户实现大行程高精度拼接和套刻需求，在新材料、前沿物理研究、半导体、微电子、光子、量子研究领域发挥重要作用。



产品特点

激光干涉样品台

先进的激光干涉样品台，满足大行程高精度拼接和套刻需求



○○○

场发射电子枪

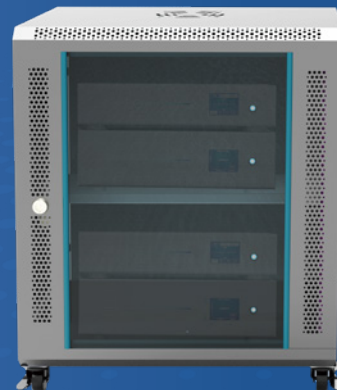
高分辨场发射电子枪是光刻质量的重要保证



○○○

图形发生器

在保证超高速的同时，实现高分辨率图形绘制



样品台指标



标配	激光干涉样品台
样品台行程	≤105 mm

电子枪及成像指标



肖特基场发射电子枪	加速电压20V~30kV；旁侧二次电子探测器和镜筒内电子探测器
图像分辨率	≤1 nm @ 15 kV；≤1.5 nm @ 1 kV
束流密度	> 7000A/cm ² ；电子束流≥100nA
最小束斑尺寸	≤2nm

光刻指标



电子束闸	上升沿<100ns
写视场	≤500×500 um
最小单次曝光线宽	< 15nm（同时取决于工艺条件）
扫描速度	≤20MHz

图形发生器参数

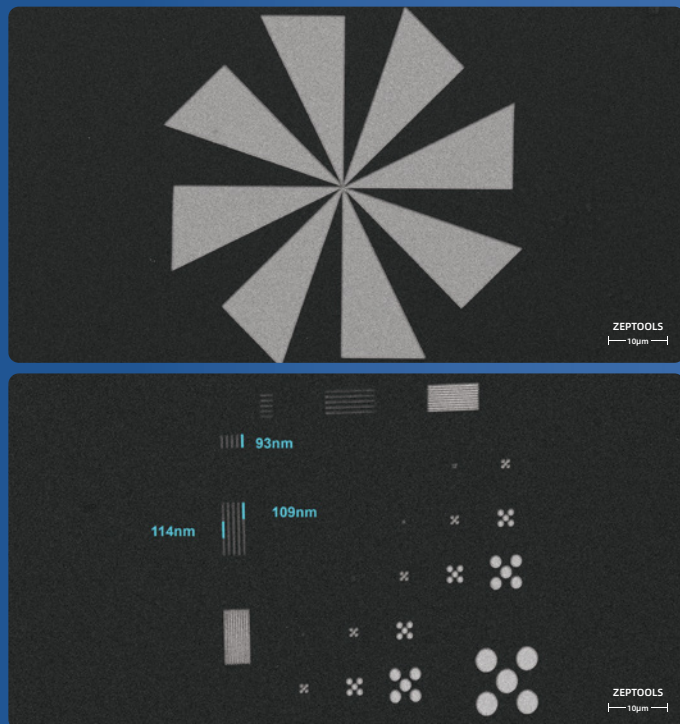


控制核心	高性能FPGA	停留时间最小增量	10ns
最大扫描速度	50MHz	图形文件格式	GDSII、DXF、BMP等
D/A分辨率	20位	法拉第杯束流测量	包含
支持的写场大小	10um~500um	临近效应校正	可选项
束闸支持	5V TTL	激光干涉位移台	可选项
扫描方式	顺序扫描（Z型）、循环扫描（S型）、螺旋型扫描等多种矢量扫描模式		
曝光模式	支持场校准、场拼接，支持套刻，支持多层自动曝光		
外接通道支持	支持电子束扫描、工件台移动、束闸通断、二次电子检测		

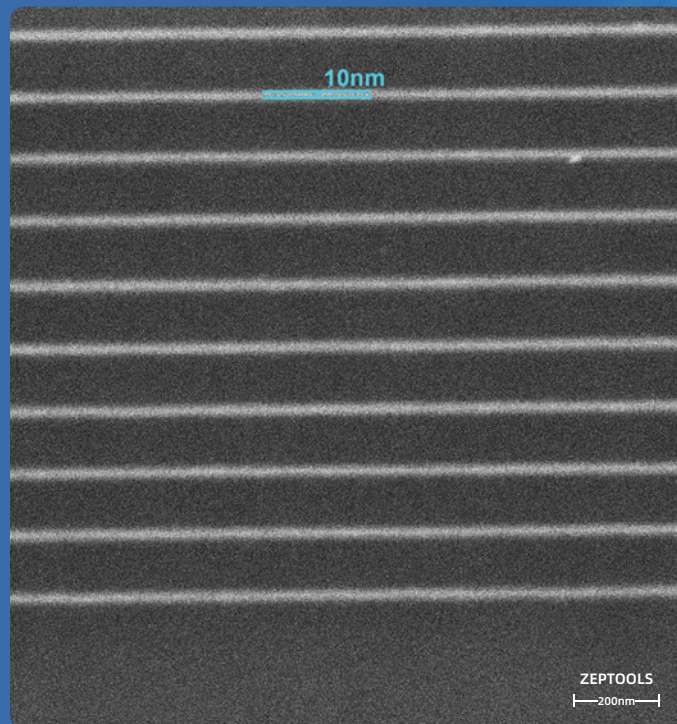
选配附件

- ◆ 配套UPS不间断电源
- ◆ 配套主动减震台，最低自然频率2Hz

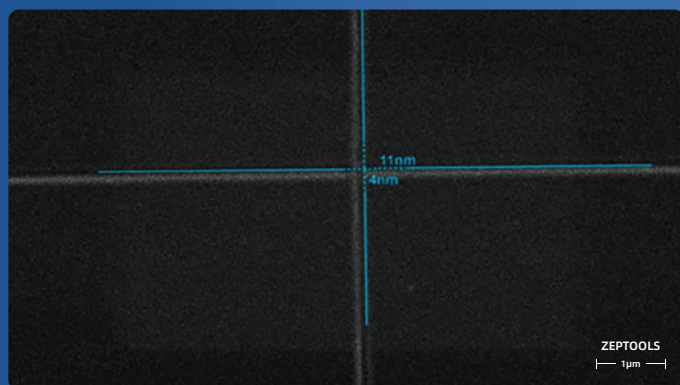
案例展示 · 大写场测试



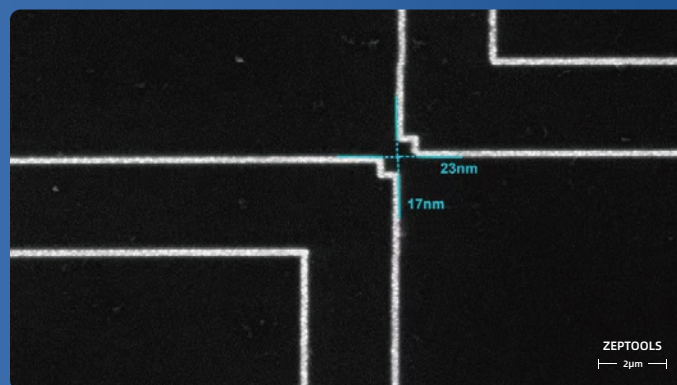
案例展示 · 最小线宽展示



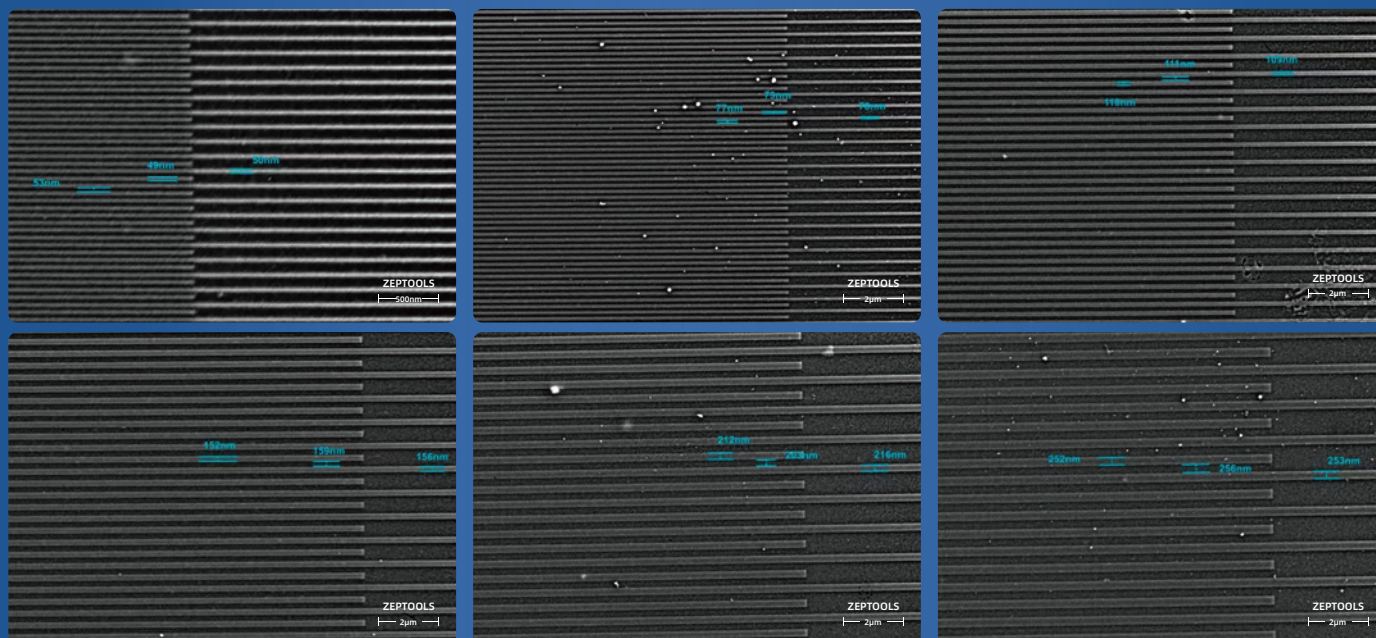
案例展示 · 场拼接精度测试



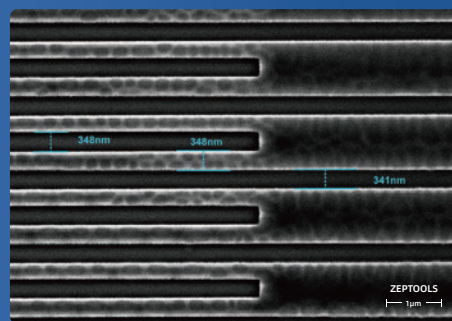
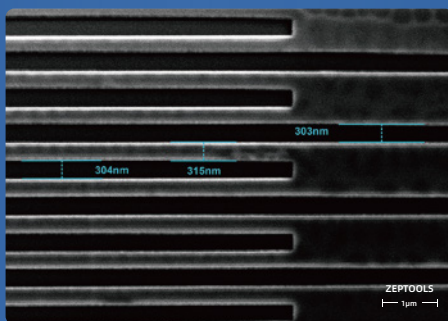
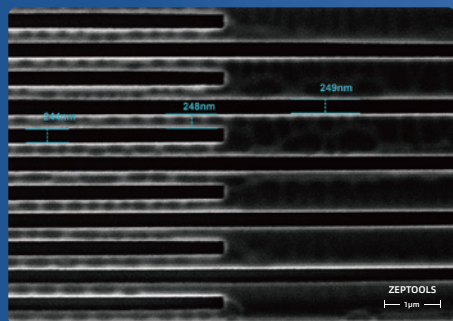
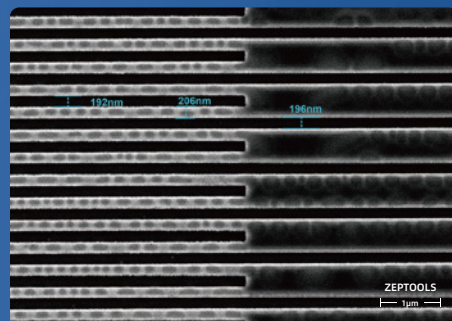
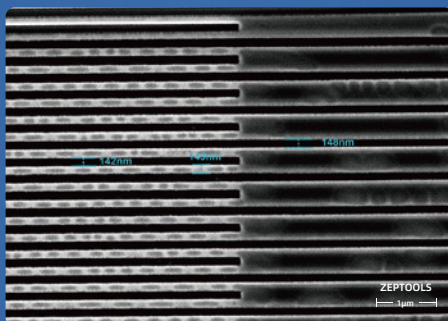
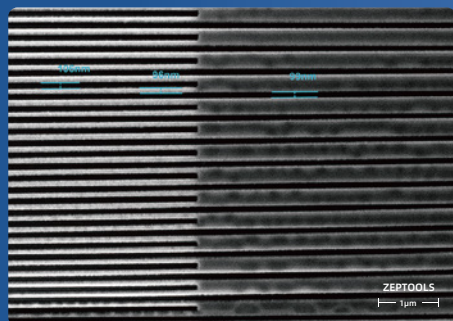
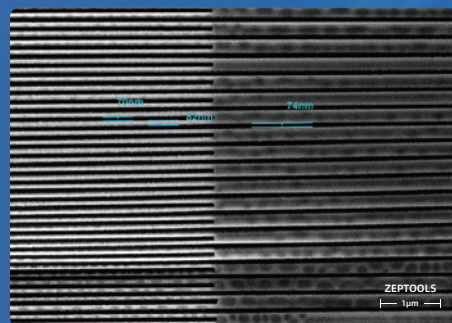
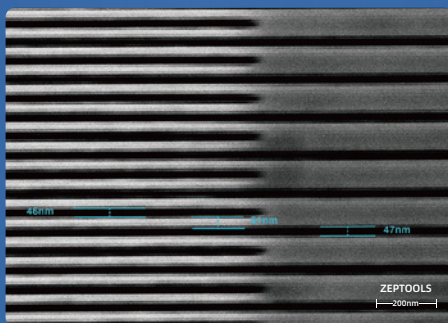
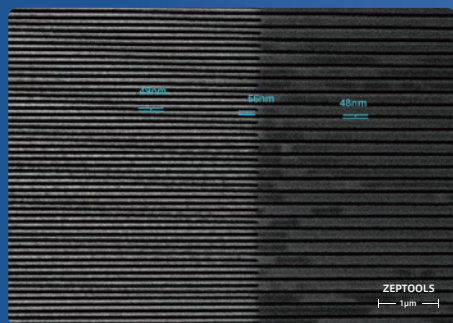
案例展示 · 套刻精度测试



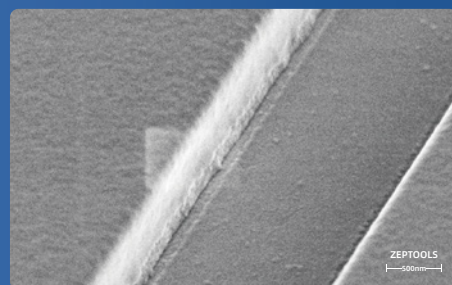
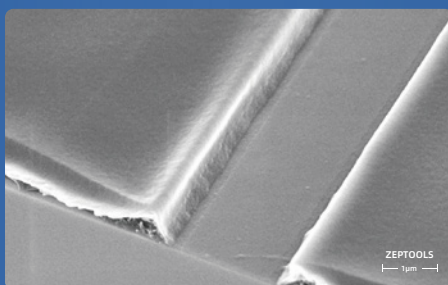
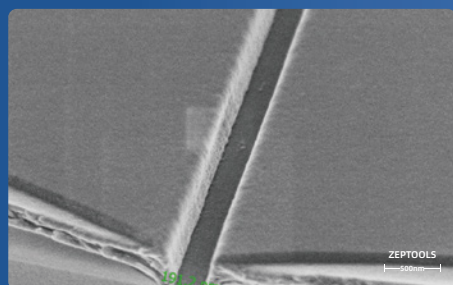
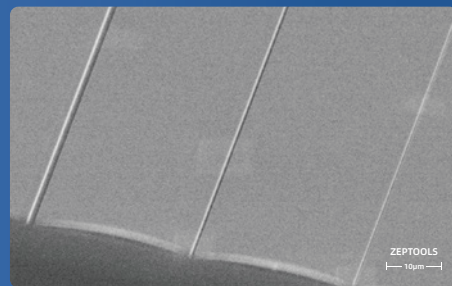
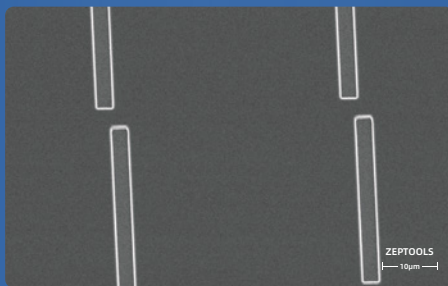
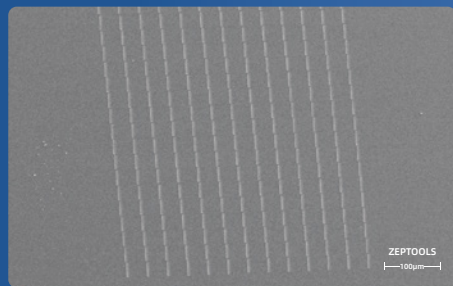
案例展示 · HSQ胶



案例展示 · PMMA胶



案例展示 · 厚胶测试



客服电话

400-966-2800

地址

泽攸官网

泽攸邮箱

www.zeptools.cn

support@zeptools.com

安徽省铜陵市经济技术开发区东市电子创业园15号楼 / 上海市闵行区吴宝路255号力国大楼113
北京市海淀区中关村软件园11号楼一层130 / 广东省东莞市大朗屏东路333号松山湖材料实验室A2栋206



泽攸科技公众号



泽攸科技客服微信